



15.結晶工学 主催シンポジウム

# シリコン結晶における 不純物制御の科学

Science of Impurity Control in Silicon Wafers

～ゲッタリングが描くウェーハの未来像～

日時

2017年 9月 5日 (火) 13:30～

会場

福岡国際会議場

招待講演

デバイスエンジニアが注目するゲッタリング技術動向

小此木堅祐 / マイクロンメモリジャパン株式会社

CMOSイメージセンサの性能への金属不純物等の影響

佐藤信彦 / キヤノン株式会社

イントリンシック・ゲッタリング能力を付与した

各種IG-Siウェーハ製品の開発経緯

宝来正隆 / 株式会社SUMCO

ゲッタリング技術開発に資する数値シミュレーション

末岡浩治 / 岡山県立大学

シリコン結晶における不純物の粒界偏析 – 微視的描像と機能 –

大野裕 / 東北大学

クラスターイオン注入によるCMOSセンサのゲッタリング技術

栗田一成 / 株式会社SUMCO

世話人

仮屋崎弘昭

(グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社)

小野敏昭

(株式会社SUMCO)

問合せ

Hiroaki\_Kariyazaki (at) sas-globalwafers.co.jp